



当前位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

电子束曝光数据处理和工艺模拟软件技术交流会在我所召开

2009-08-10 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

近日, 德国GenlSys公司副总裁Nezih Unal先生和亚太地区业务主任John Sachen先生来我所进行了为期两天的技术交流与电子束曝光数据处理和工艺模拟软件高级功能介绍等相关活动。我所电子束光刻相关工艺工作人员和研究生参加了活动, 并与专家就软件使用过程中的难点等问题进行了交流探讨。

据专家介绍, GenlSys公司的电子束曝光数据处理和工艺模拟软件Layout BEAMER 是一款多功能的电子束曝光图形数据处理软件。能够对图形数据进行布尔运算、图形单向增缩、一定尺寸范围的图形提取、多种数据格式的接受和输出; 可安装于多种操作系统; 可设置多种工艺模型、软件的图形化界面使得操作方便快捷等; 它的强大邻近效应校正功能更是其独特的性能, 可对不同工艺条件下邻近效应校正结果进行模拟, 减少试验次数, 提高效率; 它还可以产生多种类型的电子束光刻机的工作文件。此外, GenlSys公司还可以根据客户的需求开发不同的软件功能, 对客户在使用过程中出现的问题给予积极响应。

活动中, 双方还对自交叉图形的识别和处理; JEOL01格式的图形在JBX-5000LS计算机上的注册和识别; 四室在砷化镓器件研究中新的工艺层构对于电子束曝光中的邻近效应的影响和模拟等问题进行了交流探讨。其中针对有些技术难点问题GenlSys公司还将在活动后经内部讨论进一步提供解决方案。

>> 评论

通知公告

- 中国科学院微电子研究所管理人员招聘启事
- 关于召开第六届研究生会换届选举的通知
- 关于举办中层干部执行力系列培训的通知
- 中国科学院微电子所冬季拔河跳绳比赛通知

新闻动态

- > 图片新闻
- > 头条新闻
- > 综合新闻
- > 学术活动
- > 科研动态
- > 通知公告
- > 业内信息



中国科学院微电子研究所 版权所有单位名称:中国科学院微电子研究所 单位邮编: 100029
单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn